

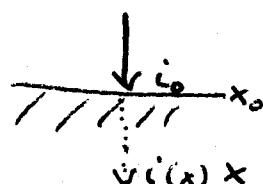
7.3. Generation, Recombination + Basic Equations

In diesem Abschnitt werden wir die dominierenden Prozesse zur Absorption von Licht und Rekombination der erzeugten e^- -Loch-Paare kennenzulernen.

7.3.1 Absorption von Licht

Da die Abschwächung eines Lichtstrahls durch Materie proportional zur jeweiligen Intensität ist: $\frac{di}{i} = -\alpha dx$ folgt das bekannte exponentielle Abfall mit der Einheitstiefe ($x-x_0$) und dem Absorptionskoeffizienten $\alpha(\omega)$, der eine Funktion der Wellenlänge des Lichts ist:

$$i(x) = i(x_0) e^{-\alpha(\omega)[x-x_0]}$$



Die Möglichkeiten zur Absorption unterscheiden sich nun stark zwischen direktem und indirektem Bandlücken Halbleitern:

Direct-Dand-Gap:

Photonen besitzen nicht große Energien (E_γ) im Vergleich zu deren Impulsen. Wir sehen hier unmittelbar von der Reibekraft des gesuchten Materials ab. Am Ende vom Tag liegen reelle Teilchen schließlich auf der Massenschale $k^2 = k_0^2 - \frac{\omega^2}{c^2} = m^2$. (Aber zurück zu Photovoltaik...)

Impuls: $\frac{\hbar}{2}$

Da die Photonen im Vergleich zum Gitterimpuls keinen Impuls mitbringen bleibt bei der Absorption des Gitterimpuls erhalten. Wir wissen aus dem Kapitel 3.2, daß & nahe der Bandgrenze die Beziehungen

$$E - E_C = \frac{P^2}{2m_e^*} ; \quad E_V - E = \frac{P^2}{2m_e^*} \text{ gilt.}$$

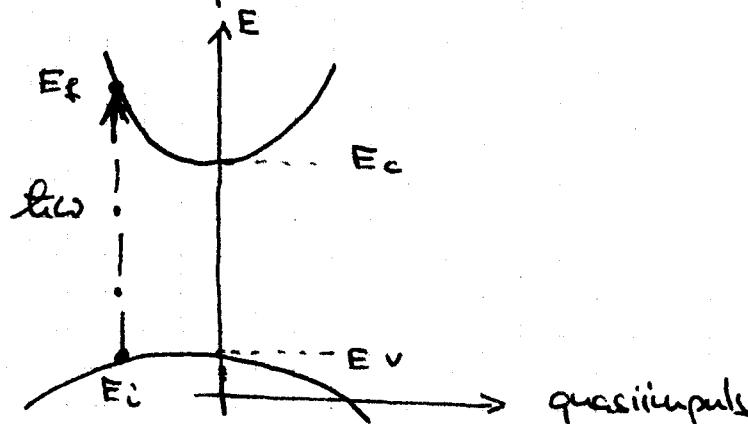
Das e^- welches ein γ absorbiert ist zunächst im Valenzband: ($E_{\text{int}} P$) und gelangt ins Leitungsband ($E_{\text{final}} P$) wobei $P_{\text{final}} = P_{\text{initial}} = P$ durch Impulserhaltung ($P_f \approx 0$):

$$\Rightarrow E_f - E_i = \hbar\omega ; \quad E_f - E_C = \frac{P^2}{2m_e^*} ; \quad E_V - E_i = \frac{P^2}{2m_e^*}$$

$$\Rightarrow E_f - E_C + E_V - E_i = \frac{P^2}{2} \left(\frac{1}{m_e^*} + \frac{1}{m_e^*} \right)$$

$$\Rightarrow \hbar\omega - E_g = \frac{P^2}{2} \left(\frac{1}{m_e^*} + \frac{1}{m_e^*} \right)$$

D.h. mit steigender Energie des γ 's sinkt der Quasiimpuls an:



Die Wahrscheinlichkeit der Absorption hängt nun von der Zustandsdichte im Anfangs und Endzustand ab.

Für gewöhnlich steigt die Zustandsdichte mit der Energie an. Wir wissen, daß nahe des Leitungsbandrandes gilt

$$N(E) \propto \sqrt{E - E_c}$$

Die meisten Zustände des e^- , welche sich noch im Valenzband befinden liegen wiederum nahe des Valenzbandrandes (sie ist schließlich die höchste Energie im Valenzband). Dazu erwarten wir ein Verhalten gemäß

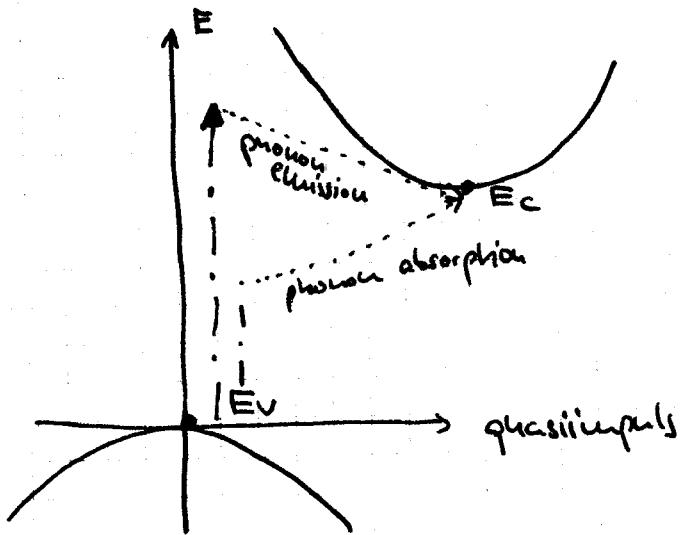
$$\begin{aligned} \alpha(\hbar\omega) &\propto N_{\text{Valenzband}}(E_V) \cdot N(E) \\ &= \text{const.} \cdot \sqrt{E - E_c} \\ &= \text{const.} \sqrt{E_V + \hbar\omega - E_c} \\ &\equiv A^* \sqrt{\hbar\omega - E_g} \end{aligned}$$

$$\text{mit der Konstante } A^* = 2 \cdot 10^4 \frac{1}{\text{cm}^2 \text{eV}}$$

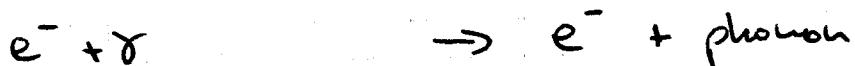
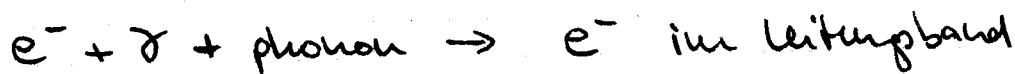
Sowohl Licht wird demnach Eindringtiefen im $[2 \cdot 10^4 \text{ cm}^{-1}]^{-1}$ Bereich aufweisen, also $x \approx \frac{1}{2} \cdot 10^{-4} \text{ cm} = \frac{1}{2} \cdot 10^{-4} \cdot 10^{-2} \cdot 10^6 \mu\text{m} = \frac{1}{2} \mu\text{m}$.

Indirect-Band-Gap

Wie wir aus Kapitel 3.2 wissen, liegt das Minimum des Leitungsbandes nicht direkt über dem Valenzband für indirekt-band-gap Halbleiter wie Silizium:



Somit muß ein e^- welches ein γ absorbiert noch zusätzlich mit einer Gitteranregung, einem Phonon wechselwirken. Phononen sind Bosonen. Der Prozess nicht also entweder eine Absorption oder Emission eines Phonons vor:



Die Wahrscheinlichkeit des Prozesses ist also proportional zu

$N_{e^-}(E) \cdot N_{\text{phonon}}(E) \cdot f_{\text{phonon}}$ für die Absorption, d.h.

$$\text{da } \frac{f_{\text{phonon}}}{N_{\text{phonon}}(E)} = \frac{1}{e^{E_p/kT} - 1} \quad \text{Bose-Einstein}$$

ist, ergibt sich

$$\text{absorption eines phonon: } \chi_a(\hbar\omega, E_p) = \frac{A[\hbar\omega - E_g + E_p]^2}{e^{\frac{E_p}{kT}} - 1}$$

$$\text{emission eines phonon: } \chi_e(\hbar\omega, E_p) = \frac{A[\hbar\omega - E_g - E_p]^2}{1 - e^{-\frac{E_p}{kT}}}$$

Da für $\hbar\omega > E_g + E_p$ sowohl Emission als auch Absorption möglich sind, ist in dem Fall die Gesamtabsoption:

$$\alpha(\hbar\omega) = \alpha_e(\hbar\omega) + \alpha_a(\hbar\omega)$$

In der Literatur gibt es Formeln für $\alpha(\hbar\omega)$, die die gemessenen Kurven sehr gut beschreiben.

PPT Bis zur Wellenlänge $> 0.4 \mu\text{m}$ sind indirekte Prozesse dominant, darüber, d.h. $\lambda < 0.4 \mu\text{m}$ gibt es einen starken Beitrag von direkten Übergängen.

7.3.2. Rekombination

Nachdem durch Photonen-Absorption e^\ominus ins Leitungsband gehoben wurden, können sie natürlich wieder mit Löchern rekombinieren.. Es gibt drei Hauptarten der Rekombination:

I. Radiative Rekombination

Ein e^\ominus kann unter Ausbildung eines γ 's in einen Valenzbandzustand zurückfallen. Dieser Prozess ist stark für direct-band-gap Halbleiter und schwächer für indirect-band-gap Halbleiter, da dazu hierfür ein phonon benötigt wird.

Die Gesamtrekombinationsrate für radiative Übergänge ist

$$R_R = B n p$$

mit B als Materialkonstante,

Im Gleichgewicht ist $n \cdot p = n_i^2$ und daraus die Netto rekombinationsrate:

$$U_R = B(n_p - n_i^2)$$

Gleich welches Mechanismus, kann man die Ladungsträgerlebenszeit definieren:

$$\tau_e = \frac{\Delta n}{U}$$

$$\tau_n = \frac{\Delta p}{U}$$

U : Netto Rekombinationsrate

$\Delta n, \Delta p$: Störungen um die Gleichgewichtswerte n_0, p_0

oder aber, da Taylor sagt: $U = \underbrace{U(n^0, p^0)}_{=0} + \frac{\partial U}{\partial n} dn + \dots$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\tau_e} = \left. \frac{du}{dn} \right|_0 ; \quad \frac{1}{\tau_n} = \left. \frac{du}{dp} \right|_0$$

Für die Strahlungsübergänge dieses Abschnitts existiert sich da $dp = dn$

$$U = 0 + \frac{\partial U}{\partial n} dn + \frac{\partial U}{\partial p} dp = dn \left(\frac{\partial U}{\partial n} + \frac{\partial U}{\partial p} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{du}{dp} = \left. \frac{du}{dn} \right|_0 = \left. \frac{\partial U}{\partial n} \right|_0 + \left. \frac{\partial U}{\partial p} \right|_0 = B(n_0 + p_0)$$

$$\text{und somit } \frac{1}{\tau_e} = \frac{1}{\tau_n} = B(n_0 + p_0)$$

$$\text{Für Silizium ist } B \approx 2 \cdot 10^{-15} \frac{\text{cm}^3}{\text{s}}.$$

Die Strahlungsrekombination ist in direct-Band-gap wesentlich stärker als in indirect band-gap.

II Auger Rekombination

Bei der Auger - Rekombination geht ein e^+ vom Leitungsband in das Valenzband über und gibt die überschüssige Energie an ein e^+ im Valenz oder Leitungsband ab, welches dann Photonen aussendet. Gleichzeitig gibt es den Effekt mit $1e^+$ und $2h$. Die Nettoraten sind demnach:

$$U_{\text{Auger}} = \beta^n n (n_p - n_i^2)$$

$$U_{\text{Auger}} = \beta^p p (n_p - n_i^2)$$

und somit die Lebensdauer mit $\tau = \alpha U$

$$\frac{1}{\tau} = \beta^n (2n_p p_0 - n_i^2 + n_o^2) = \beta^n (n_i^2 + n_o^2)$$

$$\text{bzw.: } \frac{1}{\tau} = \beta^p (2n_p p_0 - n_i^2 + p_o^2) = \beta^p (n_i^2 + p_o^2)$$

Wegen des jeweils zweiten Terms ist die Auger - Rekombination besonders effektiv in stark dotierten Halbleitern.

Für Silizium gute Qualität ist ab einer Dotierung von 10^{17} cm^{-3} die Auger Rekombination der dominante Effekt.

III Rekombination durch Fäden

Verschmutzungen und Störstellen führen zu zwätzlichen erlaubten Zuständen in der Bandlücke. Besonders gefährlich sind diese Zustände nahe der Mitte der Bandlücke.

3.3. Grundlegende Gleichungen

Hier leiten wir kurz die grundlegenden Gleichungen her, mit der wir dann auch den n-p Übergang berechnen werden. Es sind dies

I. Poisson Gleichung

In 3-D: $\operatorname{div} \vec{E} = \frac{S}{\epsilon}$ und für uns in 1-d:

$$\frac{dS}{dx} = \frac{S}{\epsilon}$$

Mit

$$S = q \left(P - n + N_D^+ - N_A^- \right)$$

Und wie wir aus Kapitel 3.2 wissen gilt in guter Näherung $N_D^+ \approx N_D$; $N_A^- \approx N_A$

II. Stromdichte

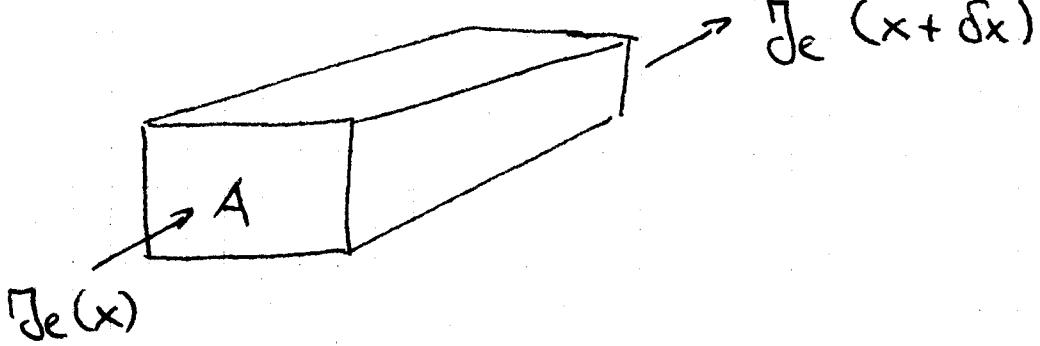
$$J_e = qneus + qDe \frac{du}{dx} ; \quad De = \frac{kT}{q} ne$$

$$J_h = qnep \xrightarrow{\text{Beweglichkeit}} - qD_h \frac{dp}{dx} ; \quad D_h = \frac{kT}{q} nh$$

Diffusionskonstante

III. Kontinuitätsgleichung

Der Strom von $n-e^-$ und Löchern kann sich nur dann ändern, wenn es zu Netto-Erzeugung oder Rekombination kommt.



Rate der eintretenden - austretenden e^\ominus im Leitungsband:

$$= \frac{A}{q} \left\{ -J_e(x) + J_e(x + \delta x) \right\} = \frac{A}{q} \frac{dJ_e}{dx} \delta x$$

dass muss also gleich sein zur Rate des Rekombination - Erzeugung:

$$= A \delta x \{ U - G \}$$

wobei U die Nettorekombinations- und G die Nettoerzeugungsrate ist. G beinhaltet z.B. die Erzeugung von e^\ominus im Leitungsband durch Lichteinfall.

Ist man im Gleichgewicht, muss gelten:

$$\frac{1}{q} \frac{dJ_e}{dx} = U - G$$

und für Löcher:

$$\frac{1}{q} \frac{dJ_{e^+}}{dx} = -(U - G)$$

womit wir (Martin Green folgend) die grundsätzlichen Gleichungen gefunden haben, die wir nun grundsätzlich lösen müssen.

$$\frac{df}{dx} = \frac{q}{\epsilon} (p - u + v_D - v_A)$$

$$I_e = q n e u \{ + q D e \frac{du}{dx}$$

$$I_n = q n e p \{ - q D n \frac{dp}{dx}$$

$$\frac{1}{q} \frac{dI_e}{dx} = u - g \quad ; \quad \frac{1}{q} \frac{dI_n}{dx} = -(u - g)$$

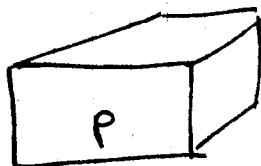
Dabei sind u und g Funktionen von u und p und im Zweifelsfall kompliziert, jedenfalls, wie wir für u gesetzen haben auch mit u^2 etc., d.h. nicht-linearen Anteilen. Mit anderen Worten: Wir haben es mit einem System nicht-linearer, gekoppelter Differentialgleichungen zu tun. Entweder, man löst das nun numerisch, oder aber - weitans mehr erhellend - Näherungsweise.

F.4.: p-n Übergang Dioden

F.4.1 Elektrostatik des p-n Übergangs

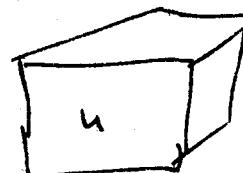
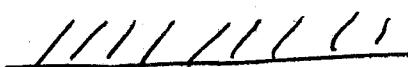
Bringt man ein Stück p und n Halbleiter zusammen, so diffundieren die e^- aus dem Leitungsband des n-Halbleiters in den p-Halbleiter (und die Löcher von p nach n). Schließlich bildet sich ein E-Feld auf, das einer Weichen Driftstrom entgegenwirkt.

Diesen Gleichgewichtszustand berechnen wir im Folgenden.



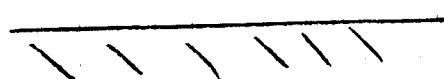
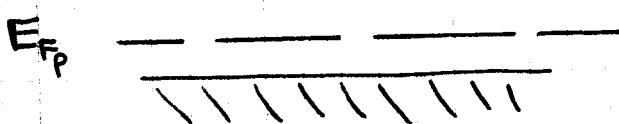
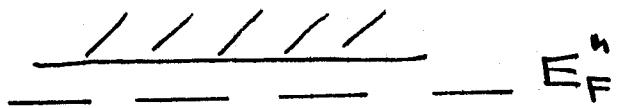
$$P = P_p^0 \approx N_A$$

$$n = n_p^0 = \frac{N_i^2}{N_A}$$



$$n = n_n^0 = N_D$$

$$P \approx \frac{N_i^2}{N_D} = P_n^0$$

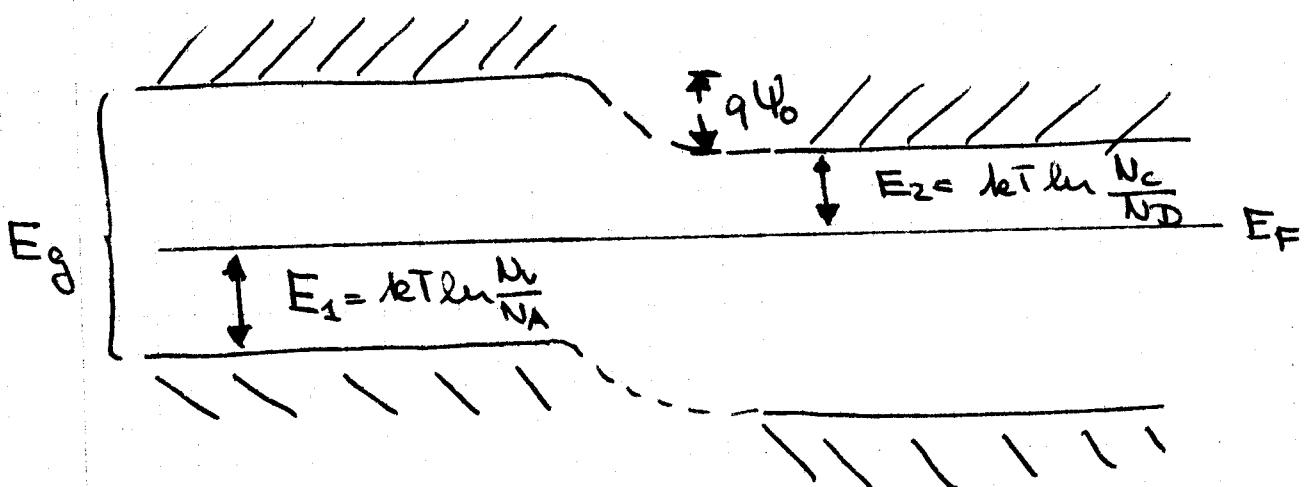
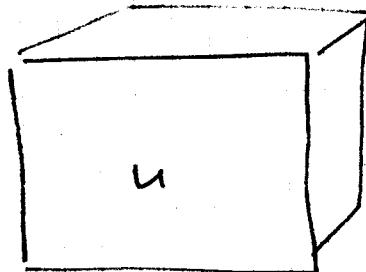
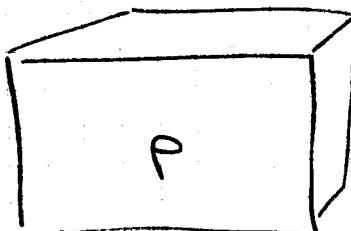


Im thermischen Gleichgewicht gibt es nur ein Fermi-Niveau. Weit weg vom Übergang erwarten man, dass die Verhältnisse sind, wie im ungestörten Zustand. Mit anderen Worten: Es muss eine Potentialänderung nahe des Übergangs geben.

Erinnern wir uns an unsere Ergebnisse aus 7.2, als wir die Lage des Fermiivecus in p + n Halbleitern berechnet haben:

$$n: E_F - E_C = kT \ln \frac{N_D}{N_C} \equiv E_2$$

$$p: E_V - E_F = kT \ln \frac{N_A}{N_V} \equiv E_1$$



Somit ist der Potentialsprung gleich

$$q\Phi_0 = E_g - E_1 - E_2 = E_g - kT \ln \frac{N_c N_v}{N_A N_D}$$

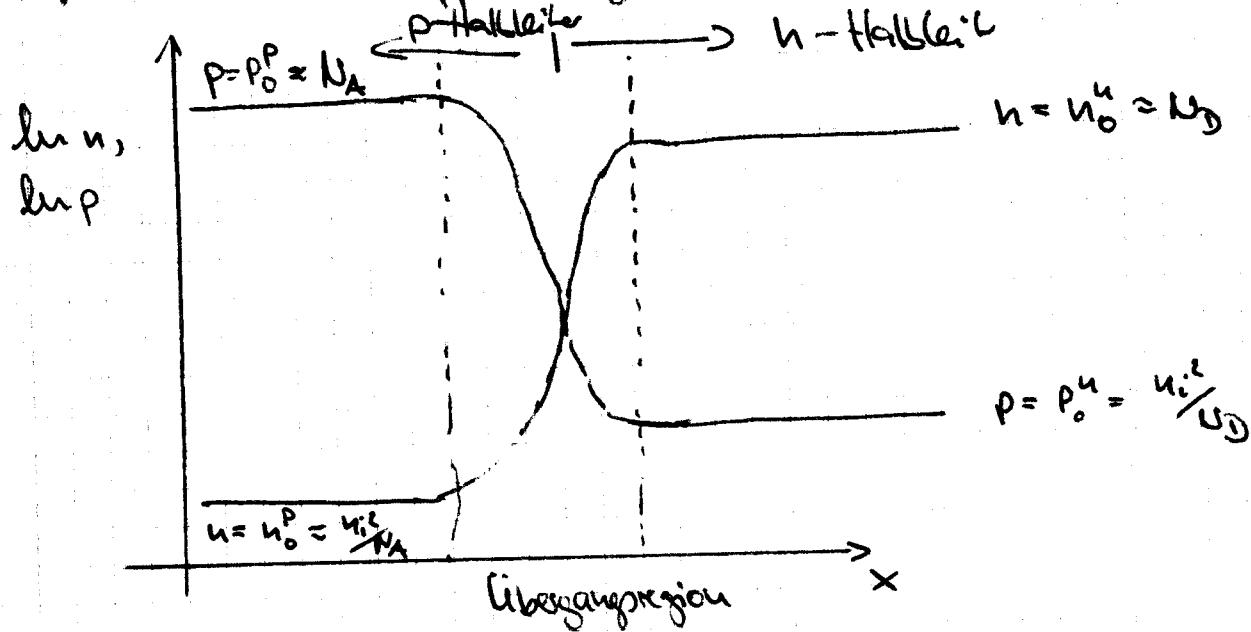
Weiterhin wissen wir aus 7.2, daß

$$n_i^2 = np = N_c N_v e^{-E_g/kT}$$

$$\Rightarrow \Phi_0 = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2}$$

Da die Konzentrationen von n und p, wie wir in Kapitel 7.2 gesehen haben exponentiell von

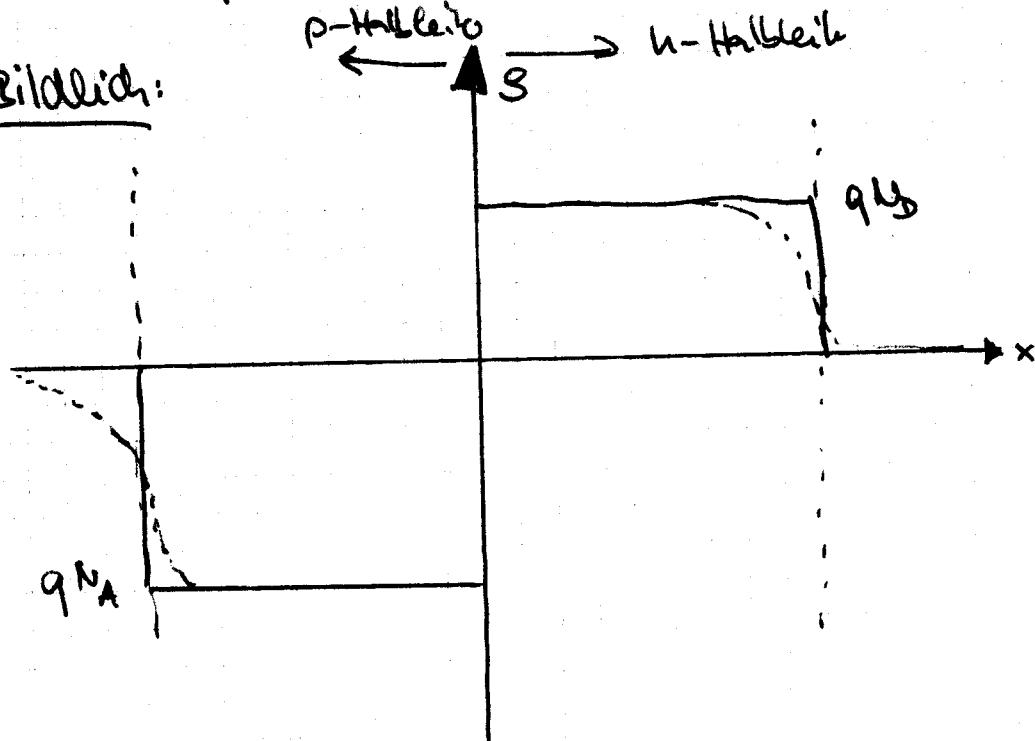
$E_F - E_C$, bzw. $E_V - E_F$ abhängt, ist der Übergang recht deutlich. Doppelt logarithmisch dargestellt:



In der Übergangsregion ist somit:

- Auf der n-Halbleiter Seite: N_D ionisierte Donatoren, aber $n \ll N_D$ e^Θ im Leitungsband
- Auf der p-Halbleiter Seite: N_A ionisierte Akzeptoren, aber $p \ll N_A$ Löcher in dieser Region

Bildlich:



Nochmals zum Verständnis. Weit weg vom Übergang, z. B. auf der n-Halbleiterseite ist $p \ll n = N_D$ und deswegen $S \approx 0$. Im Übergangsreich ist N_D noch immer dasselbe (und $N_D^+ = N_D$). Allerdings wird $n \ll N_D$ und deswegen

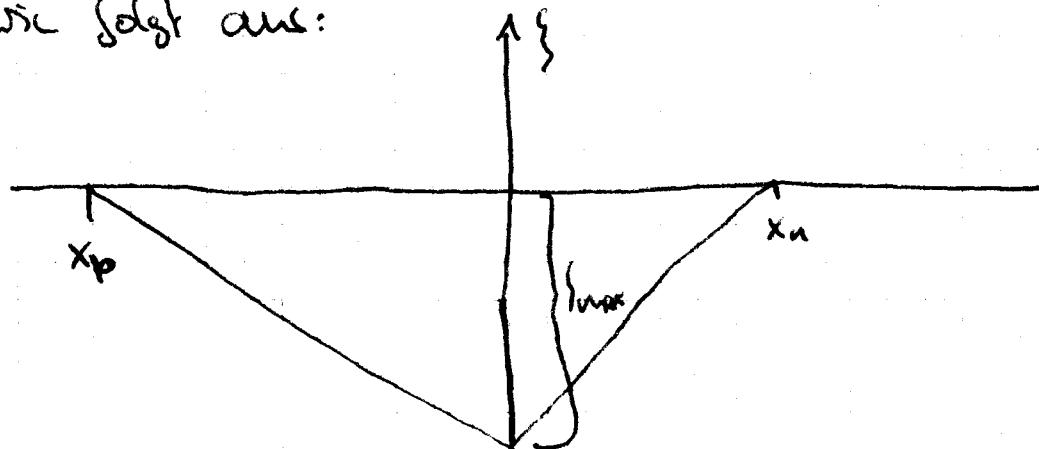
$$S = q \left(\underset{\approx 0}{p} - \underset{\approx 0}{n} + N_D - N_A \right) \approx q N_D$$

Zur Lösung unseres Problems machen wir die Verarmungs-Zonen Näherung: „Die p-n Diode wird in einen neutralen Bereich außerhalb des Übergangs und einen Verarmungs-Zonenbereich des Übergangs eingeteilt, in dem die Beiträge der Raumladung S von den ionisierten Dotierungen herstammt“.

Das macht die Lösung recht einfach:

$$\frac{dS}{dx} = \frac{q}{\epsilon}$$

Mit der wir nur im Bereich von $x_p \dots 0$ sowie $0 \dots x_n$ eine jeweils konstante Ladungsdichte $S = -qN_A$, bzw. $S = qN_D$ haben, sieht das Feld wie folgt aus:



Die maximale Feldstärke ergibt sich zu:

$$\zeta_{\max} = \zeta(x=0) = \int_{x_p}^0 \frac{d\zeta}{dx} dx = -\frac{q N_A}{\epsilon} (0 - x_p) = \frac{q N_A}{\epsilon} x_p$$

oder auch:

$$-\zeta_{\max} = \int_0^{x_n} \frac{q N_D}{\epsilon} dx = \frac{q N_D}{\epsilon} x_n$$

somit aber auch: $N_D x_n = N_A x_p$

Der Potentialsprung (genau: die Änderung) Ψ ist natürlich

$$\Psi = V(\infty) - V(-\infty)$$

$$= V(x_n) - V(x_p) \quad (\text{auf Intervall ist } \zeta = 0)$$

$$= \text{Fläche unter } \zeta \text{ Kurve} \quad (\text{da } \frac{dV}{dx} = -\zeta)$$

$$= -\frac{1}{2} (x_n - x_p) \zeta_{\max}$$

$$= -\frac{1}{2} W \zeta_{\max}$$

$$\Rightarrow \underline{\zeta_{\max} = -2\Psi/W}$$

Und die Weite berechnet man aus

$$\Psi = -\frac{1}{2} W \zeta_{\max} = \frac{1}{2} W \frac{q N_D}{\epsilon} x_n = \frac{1}{2} (x_n - x_p) \frac{q N_D}{\epsilon} x_n$$

$$= \frac{1}{2} (x_n + \frac{N_D}{N_A} x_n) \frac{q N_D}{\epsilon} x_n = \frac{1}{2} x_n^2 \left[1 + \frac{N_D}{N_A} \right] \frac{q N_D}{\epsilon}$$

$$= \frac{1}{2} x_n^2 \frac{q}{\epsilon} N_D^2 \left[\frac{1}{N_D} + \frac{1}{N_A} \right]$$

$$\Rightarrow x_n = \sqrt{24 \frac{\varepsilon}{q} \left[\frac{1}{N_D} + \frac{1}{N_A} \right]^{-1}} N_D^{-1}$$

und der $-x_p = \frac{N_D}{N_A} x_n$ ist

$$w = x_n - x_p = x_n + \frac{N_D}{N_A} x_n = x_n \left[\frac{1}{N_D} + \frac{1}{N_A} \right] N_D$$

$$= \underline{\underline{\sqrt{24 \frac{\varepsilon}{q} \left[\frac{1}{N_D} + \frac{1}{N_A} \right]}}}$$

und die zentralen Tiefen der Verarmungszone jeweils

$$x_p = -w \frac{N_D}{N_D + N_A} \quad ; \quad x_e = w \frac{N_A}{N_D + N_A}$$